

1. УСТРОЙСТВО РАСТРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА
2. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ РАСТРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА, ГЛУБИНА ФОКУСА
3. ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЭМ
4. ИНТЕНСИВНОСТЬ СИГНАЛА ОТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ. КОНТРАСТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РАЗЛИЧИЕМ В АТОМНОМ НОМЕРЕ
5. ИНТЕНСИВНОСТЬ СИГНАЛА ВТОРИЧНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ
6. КОНТРАСТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЛЬЕФОМ, МАГНИТНЫЙ КОНТРАСТ, ВОЛЬТОВ КОНТРАСТ
7. РЕНТГЕНСПЕКТРАЛЬНЫЙ МИКРОАНАЛИЗ
8. ГЕНЕРАЦИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
9. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОАНАЛИЗА
10. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ РЕНТГЕНСПЕКТРАЛЬНЫЙ МИКРОАНАЛИЗ МЕТОД ТРЕХ ПОПРАВК
11. ДИФРАКЦИЯ ОБРАТНО РАССЕЯНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ, ФОРМИРОВАНИЕ КИКУЧИ-ЛИНИЙ
12. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМИ РЭМ, РЕНТГЕНСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА, ДИФРАКЦИИ ОБРАТНОРАССЕЯНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ.

Литература

1. Практическая растровая электронная микроскопия. Под ред. Дж. Гоулдстейна и Х. Яковица. - Изд. "Мир". - Москва, 1978. - 656 с.
2. Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д., Эчлин П., Джой Д., Фиори Ч., Лифшин Э. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ: В 2-х книгах. Книга 1. Пер. с англ.-М.: Мир, 1984. -303 с.
3. Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д., Эчлин П., Джой Д., Фиори Ч., Лифшин Э. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ: В 2-х книгах. Книга 2. Пер. с англ.-М.: Мир, 1984. -348 с.
4. Черепин В.Т., Васильев М.А. Методы и приборы для анализа поверхности материалов. Изд. "Наукова думка". – Киев, 1982. – 398 с.
5. Физические основы рентгеновского локального анализа. Перев. с англ., под ред. Боровского И.Б. Изд. "Наука", Москва, 1973. 310 с.
6. Electron Backscatter Diffraction in Materials Science Edited by A.J. Schwartz, M. Kumar and B.L. Adams. Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000, - 340 p.
7. Павлинский Г.В. Основы физики рентгеновского излучения.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 240с.
8. Метод дифракции отраженных электронов в области материаловедения / под ред. А. Шварца, М. Кумара, Б. Адамса, Д. Филда – Москва: Техносфера, 2014. – 544 с.+104 с.